

掺杂的 PbTiO_3 铁电陶瓷中的正电子湮没

李龙土 何元金 郁伟中

(清华大学化学与化工系) (清华大学工程物理系)

1981年12月11日收到

正电子湮没技术 (PAT) 在材料缺陷的研究中有着广泛的应用^[1]。但它用于铁电陶瓷组分缺陷的研究则刚刚开始。Tsuda^[2,3] 等研究了掺 Gd 的 BaTiO_3 的正电子寿命谱, 证明正电子对掺 Gd 所造成的 Ba 空位是敏感的。本文报道 La, Mn 复合置换的 PbTiO_3 铁电陶瓷的正电子寿命谱测量结果。样品配料分子式为 $(\text{Pb}_{1-x} \text{La}_x \square_{0.5x}) (\text{Ti}_{0.98} \text{Mn}_{0.02}) \text{O}_3$, 其中 \square 表示 Pb 空位, x 值从 1% 到 10%。样品按陶瓷工艺制成 $20 \times 20 \times 1 \text{ mm}^3$ 薄方片。在室温 (23°C) 下进行正电子寿命测量, 实验所用的 ORTEC 系列快定时系统正电子寿命谱仪在测量 Co^{60} 的瞬发曲线时的半高宽 (FWHM) 为 280 ps。

用正电子拟合 (POSITRONFIT) 程序对谱进行三成分自由拟合。最长的寿命 τ_3 (约 2 ns) 所对应的强度 I_3 均小于 2%, 可把它归因于正电子在放射源材料中或样品表面上的湮没。所有寿命谱中都包含着较强的长寿命成分 τ_2 , 其强度 I_2 值随着掺杂量 x 的增加基本上是增大的, 但有个别样品的 I_2 值偏小, 这是因为这时相应的 τ_2 值较大。为了得到有关缺陷浓度的信息, 应该在同样的 τ_2 值条件下比较 I_2 的大小。取 320 ps (近似等于所有样品 τ_2 值的平均值) 作为固定的 τ_2 值, 在这一约束条件下对所有寿命谱进行约束拟合, 结果列于表 1。其中 χ^2/ν 是计算机程序中检验拟合好坏程度的一个参数。若实验值相对于拟合结果呈正态分布, 则 χ^2/ν 值应近似于 1; 若 χ^2/ν 值比 1 大很多, 则说明相应的谱拟合得不好。 λ_{av} , τ_m 的定义见下文。由表 1 可以看出, 随着掺杂量 x 增加

(Pb 空位浓度增大), I_2 值也增大, 这证明了 Pb 空位确实能够捕获正电子, 使正电子寿命变长。

表 1 中短寿命成分 τ_1 不单独对应一种正电子态, 它通过平均湮没率 λ_{av} 与自由态湮没相联系。 λ_{av} 的定义如下:

$$\lambda_{av} = \sum_{i=1}^3 (I_i / \tau_i), \quad (1)$$

其中 τ_i , I_i 分别表示谱中第 i 个寿命成分的寿命值和它相应的强度。 λ_{av} 通常表征自由态正电子的湮没率^[4], 在未发生相变的情况下, 它应基本不变。但表 1 中 λ_{av} 值随掺杂量 x 的改变有较大变化, 说明拟合结果不符合简单的捕获模型。在这种情况下, 我们可以用平均寿命对拟合结果加以分析, 缺陷越多, 平均寿命就越长。正电子平均寿命 τ_m 通常定义为

$$\tau_m = \frac{1}{\lambda_{av}} = \sum_{i=1}^3 (\tau_i I_i). \quad (2)$$

按照捕获模型^[5], 在假定只有 Pb 空位的捕获是主要的捕获过程, 即这一过程相对于其它捕获过程占有绝对优势的前提下, 缺陷对正电子的捕获率 μC_v 可写为

$$\mu C_v = \frac{\tau_m - \tau_f}{\tau_v - \tau_m} \cdot \tau_f^{-1}, \quad (3)$$

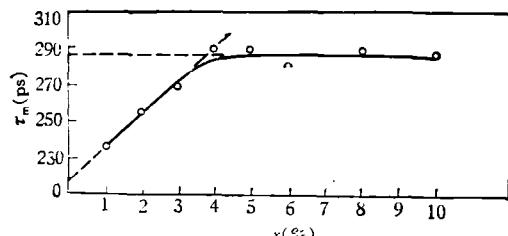
其中 C_v 为 Pb 空位的浓度, μ 为单位浓度的 Pb 空位对正电子的捕获率, 这里可以认为它等于一常数, τ_f 为 PbTiO_3 中自由正电子的寿命, τ_v 为 Pb 空位中的正电子寿命。图 1 表示正电子平均寿命 τ_m 随掺杂量 x 的变化趋势。随着 x 增加, τ_m 近似线性增大, 当 $x = 4\%$ 以后, τ_m

表 1 对寿命谱进行三成分约束拟合的结果

样品号	x (%)	τ_1 (ps)	I_1 (%)	τ_2 (ps)	I_2 (%)	τ_3 (ps)	I_3 (%)	λ_{av} (ns) ⁻¹	τ_m (ps)	χ^2/ν
PT-1	1	153±2	59.41±0.61	320	39.79±0.66	2086±345	0.79±0.06	5.14±0.09	235	1.336
PT-2	2	150±3	45.24±0.94	320	53.40±1.12	1257±167	1.36±0.20	4.69±0.18	256	0.992
PT-3	3	177±3	44.13±0.92	320	55.21±0.97	2097±450	0.66±0.07	4.28±0.13	269	1.018
PT-4	4	177±4	32.00±1.02	320	67.23±1.07	2204±443	0.77±0.06	3.91±0.16	289	1.278
PT-5	5	176±4	30.81±0.98	320	68.53±1.02	2375±577	0.66±0.05	3.90±0.16	289	0.966
PT-6	6	176±3	44.0 ± 0.91	320	55.28±0.89	3640±1227	0.72±0.06	4.23±0.13	281	1.080
PT-8	8	149±5	27.72±0.81	320	71.60±0.84	2495±938	0.68±0.06	4.10±0.23	287	1.385
PT-10	10	169±7	29.23±1.64	320	69.56±1.93	1104±209	1.21±0.33	3.92±0.26	285	1.114

的变化趋于平坦，说明正电子的捕获已趋于饱和。就是说，几乎全部正电子都是在 Pb 空位中湮没的，相当于 $C_s \rightarrow \infty$ ，由式(3)可知，这时 τ_m 接近于 τ_s 。对 $x \geq 4\%$ 以后的点用一条水平直线来拟合即可得到相应于 Pb 空位中的正电子寿命 $\tau_s = 287\text{ps}$ ；同理根据式(3)，将曲线上升段外推至 $x = 0$ 处则得到正电子在完整 PbTiO_3 晶体中湮没的自由态正电子寿命 $\tau_f =$

216ps。相比之下，捕获于 Pb 空位的正电子寿命大约比自由态寿命增大了约 $1/3$ ，这符合一般的正电子捕获理论。实验结果表明，正电子对于掺杂造成的阳离子空位是十分敏感的，而目前还很少有其它技术能对这种陶瓷中的空位浓度进行测量。因此，正电子湮没技术也许是在研究陶瓷材料中，原子尺度微观缺陷的一种潜在的有力工具。

图 1 正电子平均寿命 τ_m 与掺杂量 x 之间的关系

参 考 文 献

- [1] R. W. Siegel, *Ann. Rev. Mater. Sci.*, **10** (1980), 393.
- [2] N. Tsuda et al., *J. Phys. Soc., Jpn.*, **44-3** (1978), 914.
- [3] N. Tsuda et al., in *Proc. 5th Int. Conf. Positron Annihilation, Japan*, (1979), 479.
- [4] M. Bertolaccini et al., *J. Phys. C*, **4** (1971), 734.
- [5] W. Brandt, *Appl. Phys.*, **5** (1974), 1.

$\text{Na}_3\text{Zr}_{2-x}\text{Yb}_x\text{Si}_{2-x}\text{P}_{1+x}\text{O}_{12}$ ($x=0.2-1.2$) 系统的复平面阻抗和导纳谱

田顺宝 郭祝崑 林祖壤

(中国科学院上海硅酸盐研究所)

1981 年 12 月 25 日收到

以前的研究结果表明，用 Yb^{3+} 取代 $\text{NaZr}_2\text{P}_3\text{O}_{12}$ 中的 Zr^{4+} 和用 Si^{4+} 取代其中的 P^{5+} 相类似^[1,2]，也能提高电导率，但有一定的极限^[3]。进一步的研究表明，用 Yb^{3+} 和 Si^{4+} 混合

取代 $\text{NaZr}_2\text{P}_3\text{O}_{12}$ 中的 Zr^{4+} 和 P^{5+} 时，可以进一步提高电导率，即在 $\text{Na}_3\text{Zr}_2\text{Si}_2\text{PO}_{12}-\text{Na}_3\text{Yb}_2\text{P}_3\text{O}_{12}$ 系统中，存在着电导率很高的钠离子导体。本文报道对此系统复平面阻抗谱的研究结果。